

# 高度研所属学生の貫里拓未君

## 国際会議 Photomask Japan 2025 にて

### 「Best Academic Paper Award」を受賞

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所に所属する学生の貫里拓未君が 2025 年 4 月 16 日～18 日に開催された国際会議 Photomask Japan 2025 にて「Best Academic Paper Award」を受賞しました。

Photomask Japan は半導体の原板であるフォトマスク開発に携わる企業、要素技術の開発を進める国研、大学、企業の研究者や技術者が一同に集まり、成果を発表する国内最大のマスク原版に関する国際会議です。

貫里君は放射光施設ニュースバルで EVU リソグラフィー用素子用のアウトオブバンド（OoB）領域の反射率計を開発しています。OoB は波長 100 nm から 200 nm 付近の真空中紫外領域の光で、波長 13.5 nm の EUV に対して迷光となり、像品質の低下を招きます。今回の発表では光学素子が炭素汚染された場合の影響を評価しています。「この賞を励みに、今後は炭素汚染の状態や影響の詳細について研究したい」とコメントしています。

